

PRESENT STATUS OF THE HIMAC ION SOURCES

M.MURAMATSU, S.YAMADA, A.KITAGAWA, Y.SATO, K.TASHIRO, S.SHIBUYA*, M.YAMAMOTO*, T.KIMURA*, H.SAKAMOTO*, Y.HONDA*, H.MATSUSHITA**

National Institute of Radiological Sciences, 4-9-1, Anagawa, Inage-ku, Chiba 263.
*Accelerator Engineering Corporation, 4-9-1, Anagawa, Inage-ku, Chiba 263.
**Sumitomo Heavy Industries Co. Ltd., 5-2, Soubiraki, Niihama, Ehime 792.

ABSTRACT

Two types of ion sources, ECR and PIG, are in operation in Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba (HIMAC) at National Institute of Radiological Sciences. Ion beams like He, C, Ne, Si, and Ar are produced in the ECR and/or PIG ion sources and are utilized for the clinical trials or basic research experiments, including biology, physics, and chemistry. Recently, a movable extraction electrode was installed in the ECR ion source. Optimization of the electrode position results in the increase of the beam intensity by a factor of 2 compared to that of the previous system. For the PIG ion source, several ion source (IS) heads are prepared so that only replacement of the IS head, a very quick process, is required to change the ion species.

放医研HIMACイオン源の現状

1. はじめに

放射線医学総合研究所の重粒子線がん治療装置 (HIMAC)には、ECRイオン源とPIGイオン源の2種 類のイオン源が据え付けてある。通常、これら2つ のイオン源から He,C,O,Ne,Si,Ar,のイオンが生成さ れる。イオン源から引き出されたビームが、RFQラ イナックの入射エネルギーに満たないときは、イオ ン源とライナックの間にある加速ギャップを介して イオン源全体に電圧を印加することにより、8keV/u のエネルギーに加速し、RFQ ライナックに入射す る。入射ビームはRFQライナックとその後のアルバ レライナックで 6 MeV/u まで加速され、カーボン フォイルストリッパーによって、電子が全てはぎ取 られる。その後、ビームは上下2つのシンクロトロ ンに交互に入射され、最大 800 MeV/uまで加速され る。シンクロトロンで加速されたビームは、3つの 治療室、2つの実験用ビームライン、生物照射室に 振り分けられ、がん治療の臨床試行及び物理・生物 実験のために使用されている[1][2]。

今回は、この HIMAC の施設のうちイオン源の現 状について報告する。

2. イオン源の概要

HIMACで使用されているECRイオン源の断面図 を図1に、主な仕様を表1に示す。ECRイオン源 は、2つのミラーコイルと6極磁石によってプラ ズマの閉じこめ磁場を生成している。ミラーコイ ルは最大 600 A の電流で励磁され、最大磁場強度 は上流側で9.3 kG、下流側で7.2 kGとなる。6極 磁石の材質はNdFeBで、表面磁場は8.0 kGであ る。マイクロ波の周波数は10 GHzで、クライスト ロンによって増幅された最大1.8 kWの電力は、導 波管によりプラズマチェンバーの内部に軸方向か ら導入される。マイクロ波源は、パルスとCWの 両モードの運転が可能である。ECR ゾーンの大き さは直径40 mm、長さ60 mm と評価されている。 引出電圧は最大 25 kV である [3]。

PIGイオン源の断面図を図2に、主な仕様を表 2に示す。PIGイオン源は、熱陰極型のイオン源

表1 ECRイオン源の主な仕様

ミラーコイル最大磁場強度	9.3/7.2 kG
6 極磁石表面磁場	8.0 kG
ECRゾーン全長	60 mm
ECRゾーン直径	40 mm
ECR磁場強度 (10GHz)	3.6 kG
マイクロ波周波数	10 GHz
マイクロ波最大出力	1.8 kW
運転モード	パルス /CW
パルス幅	2 ms 以上
パルス周期	0.3~10 Hz
引き出し電源	25 kV,20 mA



で、ガスモードとスパッタモードで運転することが 可能である。PIGイオン源は、カソードの消耗を減 らし寿命を長くすることと、多価イオンのビーム強 度を増やすために、超低デューティのパルス運転を している(デューティ0.2%以下)。引出ビーム電流 による電圧降下の影響を考慮して、引出電源は40 kV,150 mAの電源を使用している[4]。

それぞれのイオン源で生成されるイオン種及び最 大ビーム強度を表3に示す。表3の下線は、ライナッ クで加速できるイオン (q/m ≥ 1/7)を示す。

RFQで加速できるビーム幅は最大1 msと短いので、 ライナックに入射する場合、ビームチョッパーを使 いビームの幅を 500 µs 程度に短くしている。

3. 性能向上のための改良

最近行われた各イオン源での性能向上のための改 良について以下に述べる。

・ECR引出電極の可動機構の追加

ECR イオン源では、引出ビーム電流に応じた最適 な電極間隔が存在している [5]。従来、引出電極を動

表 2	PIG	イオ	ン源の	主な	仕様
~~~					

偏向電磁石最大中心磁場	7 kG
偏向電磁石曲率半径	10 cm
偏向電磁石回転角	140°
スリット幅	1 mm
アーク電源	10 A,2 kV
運転モード	パルス
パルス幅	0.2 ms~8 ms
パルス周期	0.3~10 Hz
イオン源ガス	最大 2 cc/min
サポートガス	最大 30 cc/min

図2 PIGイオン源の断面図



かすには大気開放しなければならなかったが、電極 可動機構を追加したことによって、最適な電極間隔 が容易に見つけられるようになり、これにより C⁴⁺ の場合は、改造前のほぼ2倍の強度が安定して得ら れるようになった。図4に代表的な C⁴⁺ のビーム波 形を示す。改造前のビーム強度は、電極間隔を最適 化しない場合 150 から 200 eµA 程度だったが、現在 は 300 から 400 eµA である。

・PIG ヘッドの専用使用

これまでCイオンは、炭酸ガスを使い生成してい た。ガスでCイオンを生成すると、炭素が周囲の電 極等に付着する。特にカソードの周囲に付着する と、熱が逃げやすくなり、カソードの温度を安定に 保つことが出来ず、調整が困難になる。これを防ぐ ため、現在PIGイオン源では、グラファイトをNeと

表3 各イオン源で得られた最大ビーム強度											
NIRS-ECR Beam Intensity (eµA)											
Ion	m	1+	2+	3+	4	+ 5	+ 6+	7+	8+	. 9-	<b>⊢</b> .
ч	1	2500									
п т	1	2300									
He	4	<u>3200</u>	2100								
С	12		<u>470</u>	-	<u>43(</u>	<u>) 50</u>					
Ν	14		<u>790</u>	<u>590</u>	<u>34(</u>	<u>) 180</u>	<u>23</u>				
0	16		660	<u>470</u>	<u>(44(</u>	<u>) 280</u>	<u>130</u>	<u>15</u>			
Ne	20		622	<u>700</u>	680	<u>) (600</u>	) <u>220</u>	<u>54</u>	<u>10</u>	<u>0.6</u>	2
Ar	40				380	340	345	270	235	65	
PIGIS Beam Intensity $(e\mu A)$											
Ion		m	1	+	2+	3+	4+	5	÷	6+	7+
He		4	>1200	<u>0 3(</u>	000						
С	Gas	12	1000	5	000	(3000)	700	<u>20</u>			
С	Sputter	: 12	200	2	50	<u>(2300)</u>	<u>400</u>				
Ν		14		32	200	<u>2800</u>	<u>1200</u>	<u>200</u>	2		
0		16		20	000	<u>2300</u>	<u>(3000)</u>	<u>300</u>	2 3	<u>30</u>	
Ne		20		20	000	3800	<u>800</u>	<u>(400</u>	0) 2	20	
Si	Sputter	28				400	<u>600</u>	<u>300</u>	<u>1</u>	<u>45</u>	<u>10</u>
Ar		40				1500	1900	180	0 13	300	400



(上)ビーム波形 100 eµA/div (中)引出電流 10 mA/div

(下)マイクロ波入力電力 1 kW/div, パルス幅 1 ms/div

N₂の混合ガスでスパッタすることによって、Cイオ ンを生成している。それでも、ガスを使用したとき ほどではないが、スパッタされたCイオンがヘッド に付着するため、イオンを生成する場合、目的のイ オンが生成しにくくなり、イオン種の変更に時間が かかる。さらに、ビームが出ても寿命が短い。この ため、ヘッドの交換作業だけでビームを出せるよう に、各イオン種専用としてイオン源ヘッドの数を4 台に増やした。

# 4. 現在の運転状況

イオン源は毎週月曜日に立ち上げられ、土曜日の 夜まで連続運転される。通常の運転では、火曜日の 朝から金曜日の夕方までは、ECR イオン源による C+ビームの供給を、金曜日の夜から土曜日の夜(又 は日曜日の朝)までは、実験ユーザーの要求に応じ てイオン種や、イオン源の変更を行う。Cビームの 供給は、寿命が長く、ビーム強度が安定している ECRイオン源を使用している。物理・生物実験では C⁴⁺のほかHe⁺,O³⁺,Ne⁴⁺,Si⁶⁺,Ar⁸⁺等のビームを供給し ている。Ar⁸⁺はECRイオン源で、He⁺,O³⁺,Ne⁴⁺,Si⁶⁺は、 PIG イオン源で生成される。イオン源の運転はパル スモードで行われ、ECRイオン源は、C艹の場合、繰 り返し周期2Hz、パルス幅5ms、Ar^{&+}の場合は、パ ルス幅30msで運転されている。また、PIG イオン 源は、イオン種よらず、パルス幅2ms程度で運転さ れている。図5に PIG イオン源による代表的な C⁺⁺ のビームの波形を示す。

通常、機器の操作は、計算機による遠隔操作で各 機器の制御装置に値をおくり、各機器の制御が行わ



図 5 PIG イオン源のC⁴⁴ ビームの波形 (上)アーク電圧 1 kV/div, (下)ビーム波形 100 eµA/div

れている。イオン源の立ち上げは、計算機に保存さ れている過去のパラメーターをセットするだけでよ く、立ち上げ後のビーム波形は、前回の値を再現し ている。立ち上げ後のイオン源の調整は、ほとんど 行う必要がなく、1週間のビーム供給を安定に行う ことが出来る。

# 5. 今後の予定

今後は、ECRイオン源ではビーム強度増加のため に、引出電極可動機構を使いCイオン以外のイオン について、最適な電極位置の調査をする予定であ る。このほかに現在のECRイオン源では生成困難な 金属イオンを生成する18GHz ECRの開発や、Cイオ ン専用の軽イオン源の開発などがある。

#### 謝辞

この報告書を書くにあたって、重粒子治療センター の村上健業務室長と高田栄一運転室長には、助言、 指導をしていただきました。この紙面を借りて感謝 いたします。

## 参考文献

[1]. 山田聰他,重粒子線がん治療装置 [HIMAC] - その施設と前臨床実験-,アイオニクス,No.235,1995.
[2]. 村上健他,HIMAC入射器の現状,第20回リニアック技術研究会報告集

[3]. 松下浩他,NIRS-ECRの現状,「多価イオン用 ECR イオン源」研究会報告集,東大核研 INS-T-534, Dec., 1994.

[4]. Y.Sato et al., J. Appl. Phys. 76(7), p3947, 1994.

[5]. S.Fu et al., NIRS-M-96, HIMAC-005, 1993.